

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2001年8月2日 (02.08.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/55155 A1

(51) 国際特許分類: C07D 519/00, A61K 31/429, A61P 31/04 // (C07D 519/00, 487:04, 513:00)

北区師岡町760番地 明治製菓株式会社 薬品総合研究所内 Kanagawa (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/00529

(74) 代理人: 吉武賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2001年1月26日 (26.01.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2000-17418 2000年1月26日 (26.01.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 明治製菓株式会社 (MEIJI SEIKA KAISHA, LTD.) [JP/JP]; 〒104-8002 東京都中央区京橋二丁目4番16号 Tokyo (JP).

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 狩野ゆう子 (KANO, Yuko) [JP/JP]. 丸山貴久 (MARUYAMA, Takahisa) [JP/JP]. 山本康生 (YAMAMOTO, Yasuo) [JP/JP]. 設楽永紀 (SHITARA, Eiki) [JP/JP]. 佐々木鋭郎 (SASAKI, Toshiro) [JP/JP]. 栗飯原一弘 (AIHARA, Kazuhiro) [JP/JP]. 渥美國夫 (ATSUMI, Kunio) [JP/JP]. 岩松勝義 (IWAMATSU, Katsuyoshi) [JP/JP]. 井田孝志 (IDA, Takashi) [JP/JP]; 〒222-8567 神奈川県横浜市港

添付公開書類:

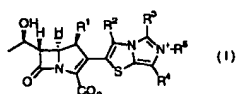
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

WO 01/55155 A1

(54) Title: NOVEL CARBAPENEM DERIVATIVES OF QUATERNARY SALT TYPE

(54) 発明の名称: 新規四級塩型カルバペネム誘導体



alkyl, etc.

(57) Abstract: Carbapenem derivatives having potent antimicrobial activities on MRSA, PRSP, influenza viruses and β -lactamase-producing bacteria and a high stability to DHP-1. Namely, compounds represented by the general formula (I) or pharmaceutically acceptable salts thereof, wherein R^1 represents H or methyl; R^2 and R^3 represent each H, halogeno, lower alkyl, etc.; R^4 represents optionally substituted lower alkylthio, etc.; and R^5 represents optionally substituted lower

[続葉有]